

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 25 年 8 月 1 日 (2013.8.1)

【公表番号】特表 2011-529440 (P2011-529440A)

【公表日】平成 23 年 12 月 8 日 (2011.12.8)

【年通号数】公開・登録公報 2011-049

【出願番号】特願 2011-521172 (P2011-521172)

【国際特許分類】

C 0 1 B 39/48 (2006.01)

B 0 1 J 29/70 (2006.01)

C 0 7 C 2/66 (2006.01)

C 0 7 C 15/085 (2006.01)

C 1 0 G 35/095 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 39/48

B 0 1 J 29/70 Z

C 0 7 C 2/66

C 0 7 C 15/085

C 1 0 G 35/095

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 25 年 6 月 14 日 (2013.6.14)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

モレキュラーシーブであって、

合成されたままの形態および焼成形態では、X 線回折パターンは 1 4 . 1 7 オングストロームから 1 2 . 5 7 オングストロームの範囲で格子面間隔 d の最大値のピークを有し、

さらに X 線回折パターンは 1 2 . 1 オングストロームから 1 2 . 5 6 オングストロームの範囲で格子面間隔 d の最大値のピークを有し、さらに

(i) 8 . 8 5 オングストロームから 1 1 . 0 5 オングストロームの間は非分離拡散であるか、または、(i i) 1 0 . 1 4 オングストロームから 1 2 . 0 オングストロームの範囲の格子面間隔 d の最大値のピークと、8 . 6 6 オングストロームから 1 0 . 1 3 オングストロームの範囲の格子面間隔 d の最大値のピークとの間に谷を示し、最下点でバックグラウンドに対して補正された測定強度が、1 0 . 1 4 オングストロームから 1 2 . 0 オングストロームの範囲の最大値と、8 . 6 6 オングストロームから 1 0 . 1 3 オングストロームの範囲の最大値とを接続する線上の同一の X R D 格子面間隔 d ポイントの 5 0 % 以上であり、

合成されたままの形態および焼成形態では、X 線回折パターンはさらに 3 . 5 7 ± 0 . 0 7 オングストローム、3 . 4 2 ± 0 . 0 7 オングストローム、および 6 . 9 ± 0 . 1 5 オングストロームでピークを含むモレキュラーシーブ。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のモレキュラーシーブであって、

以下のモル関係の組成物を有するモレキュラーシーブ。

$X_2O_3 : (n) YO_2$ 、

(Xはアルミニウム、ホウ素、鉄およびガリウムの少なくとも1つを含有する三価元素であり、Yはケイ素およびゲルマニウムの少なくとも1つを含有する四価元素であり、nは少なくとも10である。)

【請求項3】

請求項2に記載のモレキュラーシーブであって、

合成されたままの形態では、無水ベースで YO_2 のnモルに対する酸化物のモルを単位として、以下の式を有するモレキュラーシーブ。

$(0.005 - 1) M_2O : (1 - 4) R : X_2O_3 : n YO_2$

(Mはアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり、Rは有機部分である。)

【請求項4】

請求項2または3に記載のモレキュラーシーブにおいて、

前記nは10から150であるモレキュラーシーブ。

【請求項5】

請求項1に記載のモレキュラーシーブにおいて、

コリジン吸着容量が少なくとも150 μ モル/gであるモレキュラーシーブ。

【請求項6】

請求項1に記載の合成されたままの結晶性モレキュラーシーブEMM-12を製造する方法であって、

(a) EMM-10-P族組成物と、酸性組成物とを含有し、空間剤を含有してもよい混合物を供給する工程と、

(b) 混合物を処理条件下で処理して合成されたままのEMM-12を含有する生成物を形成する工程と、

(c) 酸処理された結晶性モレキュラーシーブを回収する工程とを含み、前記EMM-10-P族組成物はEMM-10-Pを含有し、前記酸性組成物は1Nの硝酸水溶液を含有し、前記空間剤はジエトキシジメチルシランを含有し、前記処理条件には90 ~ 170 の範囲の温度と、1時間 ~ 24時間の範囲の時間が含まれる方法。

【請求項7】

焼成された結晶性モレキュラーシーブEMM-12を製造する方法であって、

請求項6に記載された前記合成されたままの結晶性モレキュラーシーブEMM-12を焼成条件で焼成する工程を含む方法。

【請求項8】

炭化水素転化プロセスであって、炭化水素供給原料を請求項1に記載の前記結晶性モレキュラーシーブEMM-12と炭化水素転化条件下で接触させる工程を含む方法。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0062

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0062】

実施例1

米国特許出願番号第11/823,129の実施例1に従って作製されたEMM-10-P(1.5 g)のサンプルを、30 gの1 M硝酸及び0.3 gのジエトキシジメチルシランの混合物に添加した。オーブンの中で、パルボム(ParrTM bomb)で密閉されたテフロン容器中にて、170 で24時間反応を行った。固形の生成物をろ過して単離し、洗浄し、120 で乾燥させた。

XRD回折パターン(図2)は、6.5 ~ 7.1度2 θ (Cu K α)に対応する12.45オングストロームから13.60オングストローム間に二重線のピークがあり、8 ~ 10度2 θ (Cu K α)領域に対応する8.85から11.05オングストロームの間は非分離拡散であり、または11.05 \pm 0.18オングストロームでのピークと9.

31 ± 0.13 オングストロームでのピークとの間で谷を示すが、最下点でバックグラウンドに対して補正された測定強度は、 11.05 ± 0.18 オングストロームの近傍と 9.31 ± 0.13 オングストロームの近傍との最大値を接続する線上の同一の XRD 格子面間隔 d ポイントの 50% 以上である。

焼成された生成物は $523 \text{ m}^2/\text{g}$ という大きい表面面積および $321 \mu\text{mol/g}$ という非常に大きなコリジン吸着量を示した。

いかなる理論にも拘束されることを意図しないが、XRD によって示された層間隔が保持されることで、追加の熱安定部分が挿入されることが示され、可能性が最も高いのは Si 原子の取り込みであるとわれわれは信じる。NMR の結果はこの理論と一致する。